



三菱ガス化学株式会社

2013年3月25日

文化庁長官より感謝状を授与  
－脱酸素包装による被災文化財保護活動が評価－

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：酒井和夫）は、脱酸素包装「RP システム®」を用いた被災文化財の保存活動が評価され、本日、文化庁長官より感謝状を授与されました。

本感謝状は、「東日本大震災被災文化財等救援・修復活動への援助者に対する文化庁長官感謝状贈呈式（第3回）」にて、被災した文化財等の救援・修復活動に関し、一定の寄附又は救援物資の提供等により援助を行った企業・団体・個人に、文化庁長官より贈呈されたものです。

当社は、脱酸素技術を用いて文化財や電子部品を保存する製品「RP システム®」を使用し、岩手県陸前高田市、同・山田町などにおいて、津波により水を含んでしまった文化財の保存活動に協力致しました。本活動が評価され、この度、感謝状を賜る運びとなりました。

当社の「RP システム®」は酸素や腐食性ガスを吸収することにより、被災した文化財の錆を防ぐとともに、カビや虫から文化財を長期間保護致します。今後も貴重な文化財を後世に伝えるべく、保存活動に貢献して参ります。

<本件に関するお問い合わせ先>

広報 IR 部 TEL : 03-3283-5040